



- 主 页
- 所情介绍
- 机构设置
- 科研成果
- 杰出人才
- 研究生教育
- 学术刊物
- 对外交流
- 高科技企业
- 成果转化
- 招聘信息
- 创新文化
- 服务信息
- 链接站点

您现在的位置： 首页→成果转化→成果简介

17. 磁控溅射及多弧镀膜靶材

(中国科学院金属研究所)

一、成果内容简介：

铬靶主要用于磁控溅射镀茶色玻璃。由于铬的熔点高（约1800℃），铸造很困难，大多采用粉末烧结法，价格昂贵。中国科学院金属研究所采用均质合金特种冶炼技术，用铸造方法批量生产，降低了成本，并保证致密、杂质少，纯度高（>99.3%）。

Ti-Al合金靶材是多弧离子镀（Ti，Al）N薄膜的核心材料，要求其成分均匀，纯度高、致密。（Ti，Al）N薄膜较TiN薄膜具有更好的附着性，硬度HRC>70，韧性好，使用温度比TiN膜约高200℃，使刀具寿命提高5-6倍，因此这种薄膜在刀具镀膜行业具有广阔的应用前景。

二、主要技术指标：

Ti-Al合金靶材的杂质成分控制在C<0.03%，O<0.5%，H<0.03%。

三、应用范围：

目前国外广泛应用在汽车内燃机、精密器件的加工工业上的钻头、铣刀、车刀等刀具上，其加工精度高，延长自动生产线上使用时间，提高效率。

四、市场前景及经济效益预测：

已批量生产Ti-Al（10，20，30%）合金靶材。可根据用户对靶材成分、尺寸的不同要求，提供产品。

五、合作方式：

提供产品。

联系人：刘羽寅 联系电话：024—23971958



各类合金靶材

地址：沈阳市沈河区文化路72号 邮编：110016 管理员邮箱：webmaster@imr.ac.cn

Copyright © 中国科学院金属研究所

辽ICP备05005387号